RAF *ALD*

Le Workshop du **R**éseau des **A**cteurs **F**rançais de l'ALD
2ème Edition

14 - 15 - 16 Novembre 2016

EDF Lab, Chatou/Paris, France

www.rafald.org

Workshop annuel dédié à la technologie **ALD** (Atomic Layer Deposition)

Fédérer la communauté française, industrielle et académique

Thèmes **P**récurseurs, **C**roissance, **C**aractérisations, **S**imulations, **A**pplications industrielles
Public **C**hercheurs, **I**ndustriels, **I**ngénieurs, **D**octorants, **T**echniciens, **E**tudiants

PROGRAMME

Frais d'inscription :
150 €/ 120€ (doctorants)
Limité à 100 places
Contact : www.rafald.org

Lundi 14

13.00 - 14.00	**A**ccueil
14.00 - 14.30	**I**ntroduction
14.30 - 17.00	**T**utoriels
17.00 - 19.00	**S**ession Posters

Mardi 15

09.10 - 10.50	**P**résentations orales - Précurseurs et Simulations
11.10 - 12.40	**T**ables rondes Précurseurs / Plasma
14.40 - 16.20	**P**résentations orales - Croissance et Caractérisations
16.40 - 18.10	**T**ables rondes Caracterisation in-situ / ALD spatial
20.00 - 23.00	**D**iner de Gala

Mercredi 16

09.30 - 11.50	**S**essions oraux - Applications industrielles
11.50 - 12.30	**P**rix Poster et Prix Oral
15.00 - 17.00	**R**éunion de travail pour le GDR RAF*ALD*

COMITE SCIENTIFIQUE

N. Bahlawane (LIST) - M. Bechelany (IEM)
M. Cassir (Chimie ParisTech) - S. Daniele (IRCELYON)
J.-M. Decams (Annealsys) - C. Dussarat (Air Liquide)
A. Esteve (LAAS) - M. Gros-Jean (STMicroelectronics)
J. Kools (Encapsulix) - L. Morgenroth (IEMN)
D. Muñoz (CEA/Ines) - L. Santinacci (CINaM)
C. Valhas (CIRIMAT) - J. Vitiello (KOBUS)
D. Blanc-Pelissier (INL)

COMITE D'ORGANISATION

E. Blanquet (SIMaP) - F. Donsanti (EDF-IRDEP)
R. Gassilloud (CEA/Leti) - C. Jiménez (LMGP)
D. Lincot (CNRS-IRDEP) - T. Maindron (CEA/Leti)
A. Mantoux (SIMaP) - D. Muñoz-Rojas (LMGP)
A. Ringuede (CNRS-Chimie ParisTech)
N. Schneider (CNRS-IRDEP) - C. Vallée (LTM)